

第80回応用物理学会秋季学術講演会シンポジウム

T-20: 先端イオン顕微鏡技術って何？
ナノスケール材料・デバイスへの展開
2019年9月19日(木) 13:30 ~ 18:00 @ 北海道大学

イオン顕微鏡技術への認識を深め、今後の材料、デバイスの研究開発での有効活用を促し、イオン顕微鏡技術、および材料・デバイス技術の研究開発を加速することを目的として、近年のガスおよび金属イオン顕微鏡など先端イオン顕微鏡技術を用いたいくつかの研究成果を広く議論します。英語での発表ですが、質疑は日本語大歓迎です。

世話人: 小川真一(産総研)、水田 博(北陸先端大)
米谷玲皇(東大)、中払 周(NIMS)

講演の一部

1. The Quest for the Ultimate Focused Ion Beam in the Nano-Devices Age
Shida Tan (Intel)
2. Helium Ion Beam Lithography with High Patterning Fidelity
Kuen-Yu Tsai (NTU)
3. Neuromorphic MoS₂ memtransistors fabricated by localized helium ion beam irradiation
Hongzhou Zhang (Trinity Colledge)
4. Focused Helium Ion Beam Modified Superconductors for Quantum Electronics
Shane Cybart (UC Riverside)
5. Nanofabrication and Observation Using He/Ne Ion Microscope at Share Use Facilities
Kimihiro Norizawa (Osaka University)
6. Multispecies FIB for high resolution and large area nanofabrication applications
Andrew Yu (RAITH)
7. Usefulness of helium ion microscopy for ultrastructural cell biology
Shiro Takei (Chubu Univ.)

